

## ФАКТОР ВЫРОЖДЕНИЯ АКЦЕПТОРНЫХ УРОВНЕЙ КАДМИЯ В $Ge_{1-x}Si_x$

Г.Х. АЖДАРОВ, М.А. АКПЕРОВ, Э.С. ГУСЕЙНОВА

Институт Физики АН Азербайджана

370143, Баку, ул. Г. Джавида, 33

На основе холловских измерений кристаллов  $Ge_{1-x}Si_x$  ( $0 \leq x \leq 0,3$ ), легированных кадмием, определены факторы вырождения первого ( $\gamma_1$ ) и второго ( $\gamma_2$ ) акцепторных состояний этой примеси. Показано, что величины  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  в исследованных составах  $Ge_{1-x}Si_x$  составляют  $1,4 \pm 0,3$  и  $4,5 \pm 1,5$ , соответственно, и удовлетворительно согласуются с теоретическими значениями для факторов вырождения двухвалентных акцепторов германия.

Фактор вырождения ( $\gamma$ ), определяемый как отношение кратностей вырождения примесного уровня в состояниях содержащих электрон (дырку) и без него, является одним из основных параметров примесного центра. Знание величины необходимо как для точной статистики носителей заряда на примесном уровне, так и при сопоставлении конкретных теоретических расчетов и моделей с результатами экспериментальных данных.

Энергетический спектр основных примесных состояний кадмия в кристаллах  $Ge_{1-x}Si_x$  ( $0 \leq x \leq 0,3$ ) изучен в работах [1,2]. Установлено, что в исследованных составах кристаллов замещающие атомы примеси кадмия ведут себя как двукратные акцепторы, как и в германии. В работе [2] показано, что энергии связи первого ( $E_1$ ) и второго ( $E_2$ ) уровней кадмия изменяются линейно с составом кристалла и описываются уравнениями:

$$E_1 = (0,05 + 0,52x) \text{ эВ} \quad (1)$$

$$E_2 = (0,16 + 0,75x) \text{ эВ}$$

Здесь отсчет энергии ведется от потолка валентной зоны.

В работе [1] фактор вырождения исследовался только для нижнего уровня кадмия в германиеподобных кристаллах ( $0 \leq x \leq 0,15$ ). Было показано, что экспериментальные значения  $\gamma$  для первого уровня кадмия, определенные из холловских измерений, удовлетворительно согласуются с теоретическими, рассчитанными в рамках предположения, что в формировании основных состояний акцепторных уровней решающую роль играют волновые функции валентной зоны.

В настоящей работе представлены результаты исследований факторов вырождения первого и второго акцепторных уровней кадмия в системе  $Ge_{1-x}Si_x$  с содержанием кремния до 30 ат.%, охватывающего как германиевые, так и германиеподобные составы кристаллов.

Однородные кристаллы твердых растворов  $Ge_{1-x}Si_x$  получались методом выращивания из большого объема [3]. Легирование кадмием осуществлялось в процессе выращивания путем закладки в ампулы соответствующего количества примеси с учетом ее коэффициента сегрегации. Для управления степенью компенсации акцепторных уровней кадмия, кристаллы легировались также мелкой донорной примесью сурьмы, вводимой в кристаллы в процессе роста [4].

Фактор вырождения уровней кадмия определялся на основе холловских измерений. Для исследований отбирались образцы с нулевой степенью компенсации первого и второго акцепторных уровней кадмия. В этом случае экспериментальные данные температурной зависимости концентрации свободных дырок позволяют вычислить  $\gamma$  с помощью уравнения электрической нейтральности в кристаллах  $Ge_{1-x}Si_x$  [5].

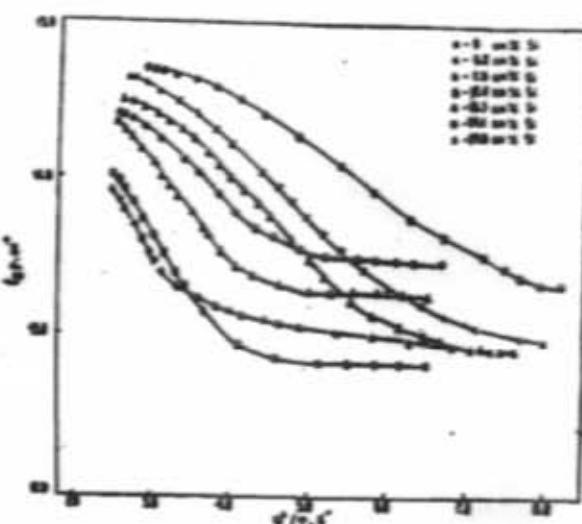


Рис. Температурные зависимости концентрации дырок в кристаллах Ge и  $Ge_{1-x}Si_x$  с нулевой степенью компенсации первого акцепторного уровня кадмия.

На рис. представлен характерный ход температурных зависимостей концентрации свободных дырок ( $n$ ) в таких кристаллах на примере нескольких образцов  $Ge_{1-x}Si_x$  различного состава, в которых проявляется первое акцепторное состояние примеси кадмия. При определении  $n$  из данных коэффициента Холла использовались значения Холла-фактора дырок в кристаллах  $Ge_{1-x}Si_x$  [6]. В области низких температур насыщение обусловлено неконтролируемыми мелкими акцепторами всегда имеющимися в кристаллах [7]. С повышением температуры начинается заполнение первого акцепторного состояния кадмия и концентрация дырок растет. Плато в области высоких температур соответствует полному заполнению этого уровня. Уравнение электрической нейтральности, описывающее ход кривых на рис. имеет вид:

$$\frac{P(P - N_a)}{N_a + N_{Cd} - P} = N_v \gamma_1^{-1} \exp(\alpha_1 / k) \exp(-E_1 / kT) \quad (2)$$

Здесь  $N_a$  и  $N_{Cd}$  – концентрация мелких акцепторов и примеси кадмия, соответственно;  $N_v$  – эффективная масса плотности состояний в валентной зоне;  $\gamma_1$  – фактор вырождения первого акцепторного уровня кадмия;  $k$  – постоянная Больцмана;  $\alpha_1$  – температурный коэффициент изменения энергии связи первого уровня кадмия.

Значения  $N_a$  и  $N_{Cd}$  определялись по данным низко- и высокотемпературным плато кривых рисунка. Значения энергии связи  $E_1$  для каждого состава вычислялись по формуле (1). Множитель в правой части уравнения (2), связанный с температурным коэффициентом изменения  $E_1$ , определялся из графика зависимости  $\exp(\alpha_1/k)$  от  $E_1$ , представленного в работе [1]. Эффективная масса плотности состояний  $N_v$  в сплавах  $Ge_{1-x}Si_x$  различного состава определялась с помощью интерполяционной процедуры с использованием известных значений эффективных масс в кремнии и германии [7]. Используя значения вышеприведенных параметров, из уравнения (2) были найдены значения  $\gamma_1$  при различных температурах для каждого состава кристалла. Для определения уточненных значений параметров  $N_a$ ,  $N_{Cd}$ ,  $E_1$  и  $\gamma_1$ , которые дают наилучшее совпадение с экспериментальными данными во всей области температур, к формуле (2) был применен метод наименьших квадратов. Результаты проведенных расчетов показывают, что в пределах погрешности экспериментов, значения  $\gamma_1$  составляют  $1.4 \pm 0.3$  и не зависят от состава кристалла. Для второго акцепторного уровня кадмия, опреде-

ленное аналогичным способом значение  $\gamma_2$  в  $Ge_{1-x}Si_x$  составляет  $4.5 \pm 1.5$ .

Ионизация первого акцепторного состояния замещающих атомов кадмия в  $Ge_{1-x}Si_x$  соответствует переходу центра из двухдырочного состояния в однодырочное. Для второго акцепторного уровня это переход из однодырочного состояния в бездырочное. Согласно теоретической работе [8], кратности вырождения этих зарядовых состояний для элементов III подгруппы в германии составляют:  $\beta_0=1$ ,  $\beta_1=4$ ,  $\beta_2=6$  (индексы 0, 1, 2 отвечают числу локализованных дырок у примесного центра). В работе [8] было принято, что акцепторные состояния элементов III подгруппы в германии образованы из волновых функций экстремума валентной зоны. В этом случае, для двухзарядных акцепторов по определению фактора вырождения имеем:  $\gamma_1=\beta_1/\beta_0=6/4=1.5$  и  $\gamma_2=\beta_2/\beta_0=6/4=1.5$ . Как видно, экспериментальные значения  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  для примеси кадмия в исследованных нами составах удовлетворительно согласуются с теоретическими значениями фактора вырождения для двухзарядных акцепторов в германии. Этот факт свидетельствует о том, что в формировании акцепторных состояний кадмия в кристаллах  $Ge_{1-x}Si_x$  с содержанием кремния до 30 ат.-% участвуют волновые функции четырехкратно вырожденного экстремума валентной зоны, как и в германии.

Как было отмечено выше, фактор вырождения первого акцепторного состояния кадмия был исследован и ранее в кристаллах  $Ge_{1-x}Si_x$  с содержанием кремния до 15 ат.-% [1]. Полученные в настоящей работе значения  $\gamma_1$  для соответствующих составов удовлетворительно согласуются с результатами [1].

- 
- [1] Г.Х. Аждаров, М.Г. Шахтахинский. Известия АН Азерб. ССР, сер. физ.-техн. и матем. наук, 1976, №4, с.8-14.
  - [2] Г.Х. Аждаров, Р.З. Кязымзаде, М.А. Азекперов, К.Н. Мамедов. Fizika, 1995, ;4, с. 27-33.
  - [3] В.И. Романенко. В кн. "Управление составом полупроводниковых кристаллов", Москва, "Металлургия", 1976, 368с.
  - [4] В.В. Мир-Багиров "Спектр основных примесных состояний меди в кристаллах твердых растворов германий-кремний". Дис. канд. физ.-мат. наук, Баку, 102 с.
  - [5] Д. Блэкмор. В кн. "Статистика электронов в полупроводниках", Москва, "Мир", 1964, 392с.
  - [6] Р.З. Кязымзаде. АзНИИНТИ, 1994, №46, с.9.
  - [7] Г.Х. Аждаров. "Энергетический спектр основных примесных состояний и гальваномагнитные свойства легированных кристаллов твердых растворов германий-кремний и соединений  $A^3B^{15}$ ". Дис. докт. физ.-мат. наук, Баку, 1981, 347 с.
  - [8] К.Я. Штильельман, Д.А. Романчев, П.Е. Ларин. Свойство легированных полупроводников. Москва, "Наука", 1977, с.5-8.

H.X. Əjdərov, M.A. Əkbərov, E.S. Huseynova

#### Ge<sub>1-x</sub>Si<sub>x</sub>-DA KADMİUMUN AKSEPTOR SEVİYYƏLƏRİNİN CIRLAŞMA FAKTORLARI

Kadmium ilə aşqarlanmış Ge<sub>1-x</sub>Si<sub>x</sub> ( $0 \leq x \leq 0,3$ ) kristallarının Holl ölçütleri asasında bu aşqarın birinci ( $\gamma_1$ ) və ikinci ( $\gamma_2$ ) akseptor seviiyelerinin cırlaşma faktorları təyin edilmişdir. Göstərilmişdir ki, Ge<sub>1-x</sub>Si<sub>x</sub>-in tədqiq olunmuş tərkiblərində  $\gamma_1$  və  $\gamma_2$  kəsiyyetləri müvafiq olaraq  $1.4 \pm 0.3$  və  $4.5 \pm 1.5$ -ə bərabərdir ki, bu da germaniumda ikiçat akseptorların cırlaşma faktorları üçün olan nəzəri qiymətlərə uyğundur.

G.Kh. Azhdarov, M.A. Akperov, E.S. Guseynova

DEGENERATION FACTOR OF CADMIUM ACCEPTOR LEVELS IN  $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$

On the basis of the Hall measurement of Cd-doped  $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$  crystals ( $0 \leq x \leq 0,3$ ) the degeneration factor of the first ( $\gamma_1$ ) and the second ( $\gamma_2$ ) acceptor levels of the impurity are determined. It is shown that in the investigated compositions of  $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$  crystals  $\gamma_1=1,4 \pm 0,3$  and  $\gamma_2=4,5 \pm 1,5$ . This result is in satisfactory agreement with the theoretical values for the degeneration factors of double acceptors in germanium.

*Дата поступления: 17.10.96*

*Редактор: М.И. Алиев*